

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年1月10日(2008.1.10)

【公表番号】特表2007-516324(P2007-516324A)

【公表日】平成19年6月21日(2007.6.21)

【年通号数】公開・登録公報2007-023

【出願番号】特願2006-542603(P2006-542603)

【国際特許分類】

C 0 8 J 3/24 (2006.01)

H 0 1 B 1/06 (2006.01)

H 0 1 M 8/02 (2006.01)

H 0 1 B 13/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 J 3/24 C E R Z

H 0 1 B 1/06 A

H 0 1 M 8/02 P

H 0 1 B 13/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月15日(2007.11.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

a) 式 - SO_2Cl で表される基を含む第1ペンダント基および式 - SO_2X' (式中、各 X' は、F および -OH からなる群から独立して選択される) で表される基を含む第2のペンダント基を含む高度にフッ素化されたポリマーを用意するステップと、

b) 前記 - SO_2Cl 基を除去することを含むプロセスにより前記ポリマーを架橋するステップであって、前記ポリマーを架橋する前記ステップ b) が前記ポリマーを電磁波に曝すことまたはラジカル開始剤に曝すことを含むステップと、
を含む架橋ポリマーを得る方法。

【請求項2】

前記ステップ b) の前に、

c) 前記ポリマーを膜に成形するステップ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。